

両面同時露光マスクアライナー

# BS425

UPDATE

ウェハ表裏同時露光で高効率  
セミオート動作で中ロット生産に対応

## φ4”試料対応両面同時露光機

1968年の登場以来ベストセラーの両面同時露光マスクアライナーBSシリーズがモデルチェンジしました。BSシリーズは水晶発振子、電力素子、LED、MEMSなど試料表裏両面加工プロセスを必要とする各種電子デバイスの研究開発から小中ロット製造用として多くの出荷実績がある露光機です。一次露光は両面同時、二次露光以降は片面づつ露光する方法※を採用するため、シンプルで応用が利くモデルです。各種ニーズに合わせたカスタマイズも承ります。 ※二次露光以降は別途 片面露光用「試料台」が必要になります。

### 特徴

- ◆試料表裏両面同時露光で高効率、高スループット。(一次露光時)
- ◆インテグレートレンズ光学系使用の高性能ランプハウス(上下)
- ◆CCDカメラ&モニタ観察2視野顕微鏡
- ◆上下マスクのレベル調整が容易な球面フローティング機能
- ◆片面露光時にマスクと試料の密着性を改善する試料吹上機能
- ◆フットスイッチにより簡単に操作できるセミオート運転
- ◆保守性が向上したフロントスライド式下側ランプハウス
- ◆特殊サイズ、形状試料に対応する専用ホルダなど各種カスタマイズ

### 【オプション】

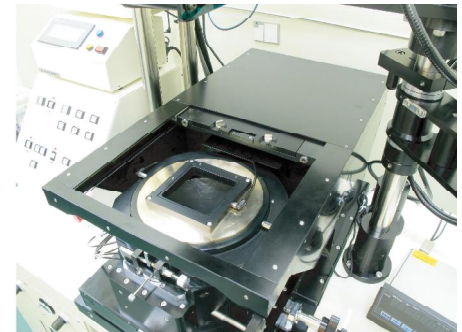
- ◆積算光量計による安定した露光量制御(上下独立)
- ◆下マスク上での試料位置決めガイド機構を搭載可能
- ◆試料台Z軸ギャップ測長器(ゼロリセット機能付き)を搭載可能
- ◆UVフィルター(各種)を装着可能

### 仕様

適用試料	最大φ4インチ(□80mmにも対応)
適用マスク	最大□5インチ マスク・ウェハサイズ変更は上下マスクホルダ交換
ランプハウス	有効露光範囲 φ125mm Hgランプ250W
UV照度	365nm 18mW/cm <sup>2</sup> 、405nm 18mW/cm <sup>2</sup> 、照度均一度 約±5%以内
露光解像度	ライン&スペース3μm(露光→現像時)
露光方式	コンタクト露光。片面露光時は試料吹上コンタクト可能。ウェハ上面のみプロキシミティ露光可能
アライメント方式	アライメント顕微鏡による上側マスクと下側マスクまたはウェハ上面の同時観察によるマニュアルアライメント。上側マスク位置基準(固定)式。
アライメント顕微鏡	カメラ&モニタ観察二視野顕微鏡 15インチモニタ時倍率 約180倍 左右対物レンズ間距離 30~100mm 観察照明 高輝度赤色LEDによる同軸射影式照明 上下マスクアライメント時には下側ランプハウスからの透過光照明も可能。
アライメントステージ	中空構造
X軸(横)、Y軸(縦)	±5mm 手動(調整ダイヤル、微動100μm/回転、粗動800μm/回転)
Z軸(上下)	0~1mm エア駆動方式(コンタクト圧調整レギュレータ付) 0~8mm 手動ねじ送り式 ギャップ測長器(分解能1μm)オプション
θ軸	±3° 手動(微動)
平行アジャスト	球面摺動機構(フローティングおよび真空ロック)
上側マスク駆動装置寸法・重量	モーター駆動による前後スライド。繰返位置決め XYθ 方向精度±1.5μm以内/100回
ユーティリティ	1600(H)×1120(W)×800(D)mm 突起部含まず 350kg 電源 AC100V 30A、真空 26.6×10 <sup>3</sup> Pa以上 ドライエア 0.6MPa以上



(改良のため仕様・意匠は変更されることがあります)



特約店

SANMEI GROUP IDENTITY  
**sanmei** 株式会社 三明  
 〒424-0825 静岡県静岡市清水区松原町6-16  
 電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648

製造元

 株式会社 ナノテック  
 Nanometric Technology Inc.  
 〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201

[www.nanotech-inc.co.jp](http://www.nanotech-inc.co.jp)  
[info@nanotech-inc.co.jp](mailto:info@nanotech-inc.co.jp)

電話(03)3960-3171 Fax (03)3960-3174